

機器名	レーザー描画装置	
メーカー名・型番	HEIDERPBERG μ PG101	
分類	半導体デバイスの加工	
仕様	100x100mm の試料を 5 ミクロンピッチでレーザー描画可能	
特徴	システムはレジスト塗布、プリベーク、レーザー描画をクラス 100 のサブクリーンルーム内で実施可能	